# ◎公開特許公報(A) 平3-31286

⑤Int.Cl.' 歳別記号 庁内整理番号 優公開 平成3年(1991)2月12日
 C 07 D 501/04 501/34 1 0 5 8615-4C 8615-4C
 8615-4C 8615-4C
 8615-4C 8615-4C

63発明の名称 ホルミル基の脱離法

②特 願 平1-164591

②出 願 平1(1989)6月27日

976 97 4 在 C 区 昭 神奈川県平塚市甲原上宿字構之内173 章 世 三共株式会社内 ②発 明 者 塩 沢 宋 男 神奈川県平塚市中原上宿字構之内173 章 地 三共株式会社

内 ②発 明 者 笹 尾 富 夫 神奈川県平塚市中原上宿字標之内173番地 三共株式会社

⑦出 顋 人 三 共 株 式 会 社 東京都中央区日本橋本町3丁目5番1号 ③代 理 人 弁理士 大野 彰夫

#### 明細書

### 1. 発明の名称

ホルミル基の脱離方法

2,特許請求の鐐囲

式

を有する化合物をメタンスルホン酸またはトリフ ルオロメタンスルホン酸で処理することを特徴と する

#

を有する化合物またはその塩の製法。

上記式中.

R¹はホルミル基または

HCONH NOCH?

を示し、R<sup>2</sup>は1-アルコキシカルボニルオキシ エチル基またはアニオンを示し、R<sup>3</sup>はアルコキ シ基または置換基を有してもよいチアンリオ基を 示しその置換基はアルキル基およびノまたはヒド ロキシアルキル基を示し、R<sup>4</sup>は水素原子または

基を示す。

#### 3. 発明の詳細な説明

### 発明の目的

本発明は、セファロスポリン誘導体の窒素原子の保護基であるホルミル基の脱離反応に関する。

本発明により得られる化合物 (2) は優れた抗 菌剤 (特開昭57-62287および特開昭60 -67483号公報) であり、化合物 (2) は化 合物(1)のホルミル基を脱離(特開昭60-67483号公報)することにより得られる。その方法は化合物(1)を鉱酸で処理する方法であり、この方法では創生物の生成ならびに化合物(1) および/または化合物(2)の分解により化合物(2)の納度が低下する

発明者等は化合物(1)をメタンスルホン酸またはトリフルオロメタンスルホン酸で処理すると 高純度の化合物(2)が得られることを見出し本 発明を完成した。

発明の構成 本発明は、

を有する化合物をメタンスルホン酸またはトリフルオロスルホン酸で処理することを特徴とする

のとドロキシアルキル越のアルキル部分のアルキ ル雄ならびにR<sup>3</sup>のチアゾリオ基の置換基のアル キル越は、たとえばメチル、エチル、プロピル、 インプロピル、ブチル、イソブチル、s - ブチル またはt - ブチルがおげられる。

化合物(2)の塩としては、たとえば塩酸塩、 硫酸塩、メタンスルホン酸塩またはトリフルオロ メタンスルホン酸塩があげられる。

化合物 (2) は下記の方法により得られる。 化合物 (1) を将媒に懸濁または溶かし、これに 1~5 当量好ましくは2~3 当量のメタンスルホン酸またはトリフルオロメタンスルホン酸を加え、この溶核を0~50 で好ましくは20~40でに 10分間~2時間保ち、この反応混合物を常法に従って処理すると化合物 (2) が得られる。

本反応に使用される溶媒は、たとえばメタノール, エタノール, プロパノール, イソプロパノール, ・ テトラヒドロフラン, アセトニトリル, N, Nージメチルアンメチルホルムアミド, N, Nージメチルア セトアミド, ジオキサンまたはトルエンがあげら

式 R<sup>4</sup>NH 5

$$\begin{array}{ccc}
R^4 NH & & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & &$$

を有する化合物またはその塩の製法である。 上記式中、

R'はホルミル基または HCONH

 $R^2$ の1-アルコキシカルボニルオキシエチル基、 $R^3$ のアルコキシ拮およびチアゾリオ装の置換装

れる。

## 発明の効果

従来法に比較して反応条件が緩和であるために 剛生成物および分解生成物が少なく、高純度の化 合物(2)が得られ、かつ剛生成物および分解物 が少ないので化合物(2)の収率もよい。

以下に実施例をあげ本発明を具体的に示す。 実施例1

(RS) -1- (イソプロピルオキシカルボニ ルオキシ) エチル (6R, 7R) -7- (2-(2-アミノチアゾール-4-イル) -2- (Z) -メトキシイミノアセトアミド) -3-メトキシ メチル-3-セフェム-4-カルボキシレート 乾繰した原料ホルミル体32.6gをメタノール197

他級した原料ホルミル体32.0gをメタノール197 ■1に懸濁させ、内温を25で±1でに保つ様にしながらメタンスルホン酸10.5g(2eq)を加え同温度を保ちながら攪拌を続ける。30分で均一溶液となり反応も完結する。反応液に水550m1と活性炭6.5g。 を加え十分機能した後ろ過し、ろ被をアンモニア 水又は炭酸水でpH5.5~6.0に調整し10℃に冷却し 1時間機能した後ろ取、水で洗浄後減圧下乾燥し 目的物28.0g(収率90%,含量96%)を得た。

なおこの操作中に△<sup>2</sup>体および7ー置換部分の E体(アンチ体)が0.1~0.2%副生する。これに たいして鉱酸、例えば塩酸で反応を行った場合、 反応が完結するまで4時間もかかり、△<sup>3</sup>体およ びE体(アンチ体)が1%も副生し、他の分解物 も生成するため、本方法に比較して化合物(2) の純度の低下が認められた。

核磁気共鳴スペクトル(CDC1<sub>3</sub>,δppm): 1.33(6H,d,J=5Hz), 1.59(3H,d,J=5Hz), 3.34(3H,s), 3.58(2H,s), 4.04(3H,s), 4.35(2H,s), 4.92(Hm,m), 5.08(1H,d,J=3.5Hz), 5.27(2H,d,J=3.5Hz), 5.01(1H,m), 6.88(1H,s), 6.95(1H,q,J=6Hz), 7.31(1H,d,J=4Hz)

## 実施例2

<u> 7-アミノー3ー [3- (4-メチルー5-</u>

次いで0~5℃に冷却しトリエチルアミン1.58gを加えさらに1時間提拌後折出した結晶をろ取し、 冷エタノール10mlで洗浄後減圧下乾燥し目的物2. 87gを得た。

核磁気技鳴スペクトル( $d^4$ -DMSO, $\delta$  ppm): 2.8~3.5(2H),5.02(1H,d,J=4.5Hz), 5.1~5.5(2H),5.70(JH,m),7.10(2H,bF),8.1~8.4(JH,m),8.7~9.1(JH,m),10.3~10.5(JH,m)

## 実施例4

原料ホルミル体40gをメタノール400mlに溶解し メタンスルホン酸19gを加えた後室温で30分機拌 後、0~5でに冷却しこれにトリエチルアミン28ml を加えさらに1時間提拌する。析出物をろ取し冷 (2-ヒドロキシエチル) チアゾリオ) メチルー 3-セフェム-4-カルボキシレート塩酸塩

原料ホルミル体塩酸塩32.8gをメタノール330ml に溶解しメタンスルホン酸15gを滴下し40℃で40 分反応後、0~5℃に冷却しトリエチルアミン15.8 gを同温度で加えらに1.5時間提拌を続ける。折 出した結晶をろ取し、冷メタノール66mlで洗浄し 被圧下乾燥し目的物20.2gを得た。

核磁気共鳴スペクトル(d<sup>5</sup>-DMSO, δ ppm): 2.47(3H,s), 2.8~4.0(6H,m), 5.10(1H,d,J=4.5Hz), 5.35(2H,br), 5.62(1H,d,J=4.5Hz), 10.20(1H,s)

#### 実施例3

<u>7-アミノ-3-(3-チァソリオ)メチルー3-セフェム-4-カルボキシレート塩酸塩</u>

7-ホルムアミド-3-(3-チアゾリオ) メ チル-3-セフェム-4-カルボキシレート塩酸 塩3.6gをエタノール50miに溶解し、これにメタン スルホン酸1.5gを流下後40℃で30分間提拌する。

メタノール100mlで洗浄後減圧下乾燥し目的物33g を得た。

核磁気共鳴スペクトル(d<sup>6</sup>-DMSO, 8 ppm): 2.39(3H,s), 3.20(2H,t,1=5Hz), 3.38(2H,s), 3.65(3H,t,1=5Hz), 3.83(3H,s), 5.18(1H,d,1=5Hz), 5.39~5.54(2H,m), 5.85(1H,dd,1=5Hz,8Hz), 6.73(1H,s), 7.22(2H,s)

> 出願人 三共株式会社 代理人 弁理士 大野彰夫

手 紅 補 正 巻 (カ 式)

平成1年9月29日

特許疗及宜服

1. 事件の表示

平成1年特許顯第164591号

2. 発明の名称

ホルミル基の脱離法

3. 細形をする者

事件との関係 特許出順人

住所 〒103 東京都中央区日本橋本町3丁目5番1号

名称 (185) 三共株式会社

代表者 取締役社長 河 村 喜 典

4. 代班人

居所 〒140 東京都品川区広町1丁目2番58号

三 共 株 式 会 社 内 電話 492-3131

氏名 弁理士 (8140) 大 野 彩 大

5. 補正命令の日付 平成1年9月26日 (発送日)

6 . 補正の対象 明編書の発明の名称の個

7. 細正の内容

明期型の発明の名称を「ホルミル族の脱離法」と打定する